

2006年中国知識産権局年度報告書概要

2007年6月末、中国知識産権局は2006年年度報告書を発表し、その概要を纏めてご参考されたい。その詳細は、
<http://www.sipo.gov.cn/sipo/gk/ndbg/2006NB/>をご参考ください。

一、特許出願

(1) 特許出願量及びその構成

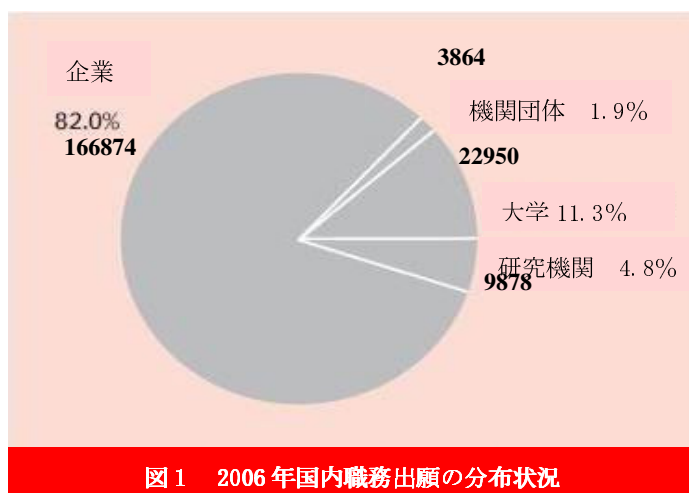
2006年、中国国家知的財産権局は、特許出願を573,178件受理した。出願量は2005年より20.3%、96,914件増で、国内外の三種類の特許の出願と職務、非職務別で以下の表に統計された。

表1 2006年国内外三種の特許出願の統計（職務、非職務別で）

特許種類		合計			国内			外国からの出願		
		合計	職務	非職務	合計	職務	非職務	合計	職務	非職務
総累計	出願量	3334367	1613438	1720929	2727857	1032712	1695145	606510	580726	25784
	%	100.0%	48.4%	51.6%	100.0%	37.9%	62.1%	100.0%	95.7%	4.3%
2006	合計	573178	303174	270004	470342	203566	266776	102836	99608	3228
	出願量	573178	303174	270004	470342	203566	266776	102836	99608	3228
	%	100.0%	52.9%	47.1%	100.0%	43.3%	56.7%	100.0%	96.9%	3.1%
	発明	210490	167319	43171	122318	81485	40833	88172	85834	2338
	出願量	210490	167319	43171	122318	81485	40833	88172	85834	2338
	%	100.0%	79.5%	20.5%	100.0%	66.6%	33.4%	100.0%	97.3%	2.7%
	実用新案	161366	59846	101520	159997	58769	101228	1369	1077	292
	出願量	161366	59846	101520	159997	58769	101228	1369	1077	292
	%	100.0%	37.1%	62.9%	100.0%	36.7%	63.3%	100.0%	78.7%	21.3%
	意匠	201322	76009	125313	188027	63312	124715	13295	12697	598
	出願量	201322	76009	125313	188027	63312	124715	13295	12697	598
	%	100.0%	37.8%	62.2%	100.0%	33.7%	66.3%	100.0%	95.5%	4.5%

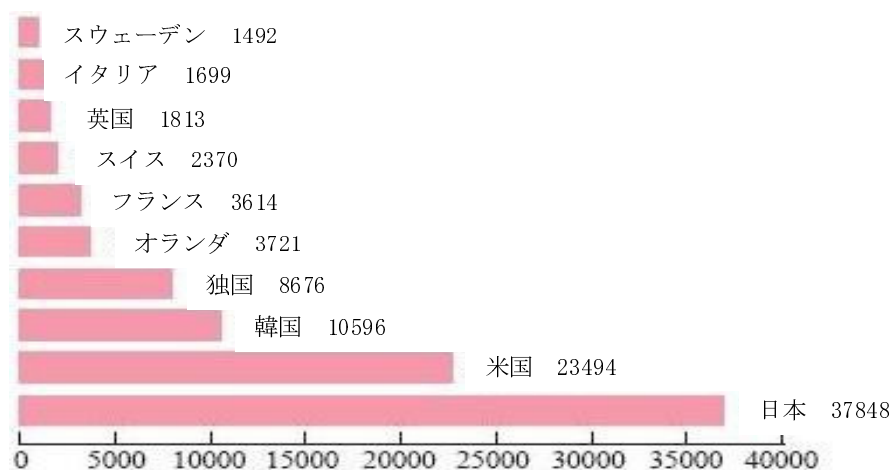
(2) 国内職務発明特許および外国からの出願の詳細

A、国内職務発明



B、外国からの特許出願の分布状況（外国出願量国別トップ 10）

図 2 2006 年に外国出願量トップ 10



C、国内職務発明出願量トップ 10

表 2 2006 年国内職務発明出願量トップ 10

コード	企業名称	出願量
1	華為技術有限公司	5947
2	中興通迅股份有限公司	2572
3	鴻海精密工業股份有限公司	1982
4	鴻富錦精密工業（深圳）有限公司	1543
5	比亞迪股份有限公司	1021
6	英業達股份有限公司	998
7	深圳市海川実業股份有限公司	816
8	海尔集团公司	790
9	仏山市順徳区順達電腦厂有限公司	677
10	楽金電子（中国）研究開発中心有限公司	676

表 3 2006 年国内大学別出願量(トップ 10)

コード	大 学	出願量
1	浙江大学	1476
2	清華大学	909
3	上海交通大学	875
4	東南大学	569
5	華南理工大学	512
6	哈爾浜工業大学	432
7	天津大学	411
8	北京航空航天大学	376
9	復旦大学	365
10	四川大学	353

表 4 2006 年国内研究所別出願量(トップ 10)

コード	研究所	出願量
1	財団法人工業技術研究院	495
2	貴陽鋁鎂設計研究院	421
3	中国科学院上海光学精密機械研究所	262
4	中国科学院大連化学物理研究所	236
5	中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院	225
6	中国科学院半導体研究所	173
7	中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究所	151
8	中国科学院長春応用科学研究所	150
9	中国科学院長春光学精密機械与物理研究所	132
10	中国科学院化学研究院	126

表 5 2006 年外国企業別出願量(トップ 10)

コード	国家	企 業	出願量
1	韓国	サムスン電子株式会社	4355
2	日本	松下電器産業株式会社	3067
3	オランダ	ロイヤルフィリップスエレクトロニクス	2503
4	日本	ソニー株式会社	1648
5	韓国	LG 電子株式会社	1506
6	米国	IBM	1435
7	日本	株式会社東芝	1211
8	日本	セイコーエプソン株式会社	1144
9	独国	シーメンス	887
10	日本	株式会社日立製作所	836

表6 2006年国内企業別の発明特許出願量(トップ10)

コード	企業名称	出願量
1	華為技術有限公司	5593
2	中興通迅股份有限公司	2322
3	鴻海精密工業股份有限公司	1223
4	鴻富錦精密工業(深圳)有限公司	1220
5	深圳市海川実業股份有限公司	760
6	英業達股份有限公司	677
7	中国石油化工股份有限公司	619
8	楽金電子(中国)研究開発中心有限公司	607
9	楽金電子(天津)電器有限公司	537
10	友達光電股份有限公司	530

表7 2006年国内大学別の発明特許出願量(トップ10)

コード	大学名称	出願量
1	浙江大学	1209
2	上海交通大学	841
3	清華大学	817
4	哈爾濱工業大学	408
5	華南理工大学	391
6	天津大学	367
7	復旦大学	337
8	北京航空航天大学	334
9	四川大学	298
	上海大学	298
	南京大学	298
	北京大学	298

表8 2006年国内研究所別の発明特許出願量(トップ10)

コード	科研院所名称	数量
1	財団法人工業技術研究院	488
2	中国科学院大連化学物理研究所	232
3	中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院	216
4	中国科学院半導体研究所	171
5	中国科学院上海光学精密機械研究所	161
6	中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究所	147
7	中国科学院長春応用科学研究所	146
8	貴陽鋁鎂設計研究院	144
9	中国科学院化学研究院	126
10	中国石油化工股份有限公司撫順石油化工研究所	122

表9 2006年外国企業別の発明特許出願量(トップ10)

コード	国家	企業名称	数量
1	韓国	サムスン電子株式会社	3770
2	日本	松下電器産業株式会社	2679
3	オランダ	ロイヤルフィリップス エレクトロニクス	2369
4	米国	IBM	1435
5	日本	ソニー株式会社	1441
6	韓国	LG 電子株式会社	1230
7	日本	株式会社東芝	1117
8	日本	セイコーエプソン株式会社	1089
9	独国	シーメンス	872
10	韓国	サムスン SDI 株式会社	818

(3) 技術分野別の特許出願情況

2006年、中国国家知識産権局は、発明及び実用新案特許出願に対して国際特許分類(IPC)を384090件行い、分類された量は、2005年より33.8%、96,964件増でした。

表10 2006年発明及び実用新案の特許出願分類状況 (IPC)

	総計	A	B	C	D	E	F	G	H
総累計	2315074	509661	432819	226979	48341	144993	291142	318844	342295
	100.0%	22.0%	18.7%	9.8%	2.1%	6.3%	12.6%	13.8%	14.8%
2006年累計	384090	74733	63605	39720	6780	21042	44359	61225	72626
	100.0%	19.5%	16.6%	10.3%	1.8%	5.5%	11.5%	15.9%	18.9%
発明	218163	36106	25319	35690	3921	6512	15044	42954	52617
	100.0%	16.6%	11.6%	16.4%	1.8%	3.0%	6.9%	19.7%	24.1%
実用新案	165927	38627	38286	4030	2859	14530	29315	18271	20009
	100.0%	23.3%	23.1%	2.4%	1.7%	8.8%	17.7%	11.0%	12.1%

2006年出願の国際特許分類 (IPC) の特徴

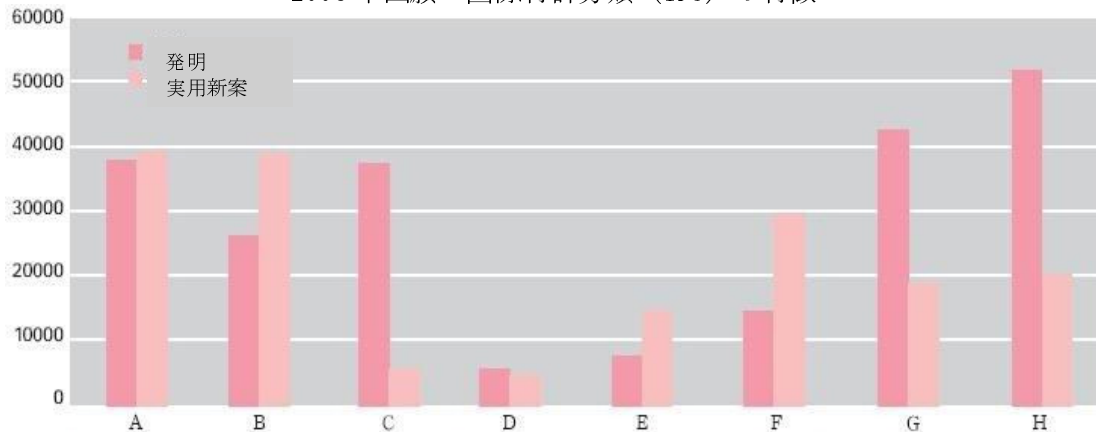


図3 2006年発明及び実用新案の特許出願分類状況 (IPC)

2、拒絶査定不服審判及び特許権無効審判

(1) 拒絶査定不服審判の受理及び審決情況

事件類型	受理件数	比率
特許出願拒絶査定不服審判	2824	97.58%
実用新案出願拒絶査定不服審判	53	1.83%
意匠出願拒絶査定不服審判	17	0.59%
合計	2894	100.00%

1985 年から、専利復審委員会は、拒絶査定不服審判請求事件を 14882 件受理し、2006 年末現在係属している事件は 4,442 件である。

(2) 無効審判請求事件及び審決

事件類型	受理件数	比率
特許権	356	14.42%
実用新案権	1136	46.03%
意匠権	976	39.55%
合計	2468	100.00%

1985 年から、専利復審委員会は、無効審判請求事件を 16,866 件受理し、2006 年末現在係属している無効審判請求事件は、2,707 件である。

3、行政訴訟

事件類型	受理件数	比率
特許出願拒絶査定不服審判事件	61	9.92%
特許権無効審判事件	119	19.35%
実用新案出願拒絶査定不服審判事件	0	0.00%
実用新案権無効審判事件	256	41.63%
意匠権無効審判事件	178	28.94%
その他	1	0.16%
総計	615	100.00%

4、一部の技術分野における特許出願情況

(1) 水処理

2000年から2006年9月までに、水処理に係る中国特許出願は6,107件で（その中、PCT出願は822件で）、年間伸び率は約10%である。図4は、2000年から2006年9月までに、PCT出願を除いて中国特許出願における国内出願量の推移を示す図である。

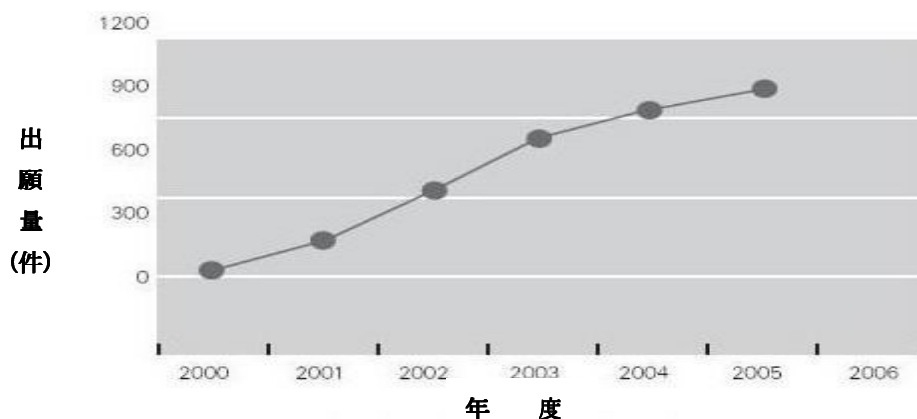


図4 中国特許出願における国内出願量の推移（PCT出願を除く）

図5は、2000年から2006年9月までに、PCT出願を除いて中国特許出願における外国からの出願量の分布状況を示す図である。

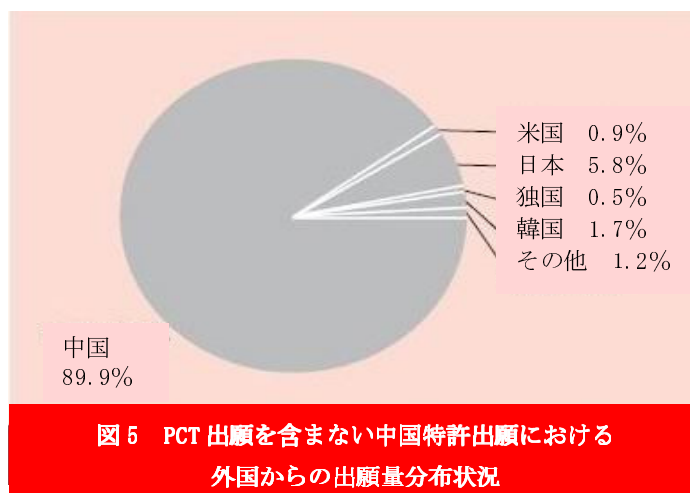


図5 PCT出願を含まない中国特許出願における外国からの出願量分布状況

図6は、2000年から2006年9月までに、PCT出願における外国からの出願量の分布状況を示す図である。

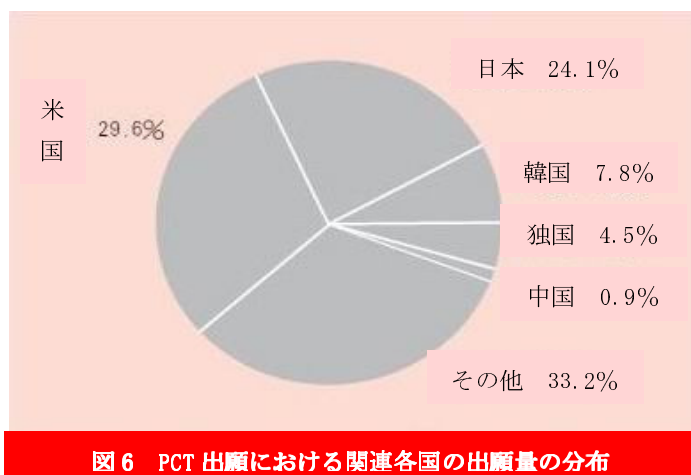


図 7 は、2000 年から 2006 年 9 月までに、国内出願における主な水処理技術に係る出願の分布状況を示す図である。

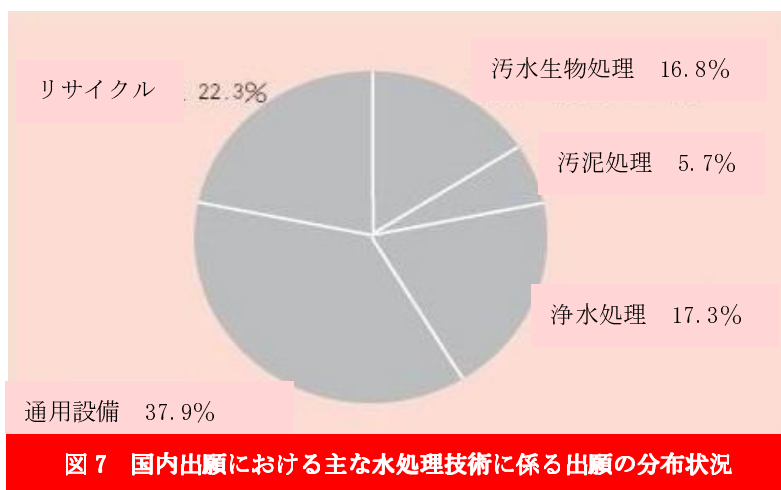
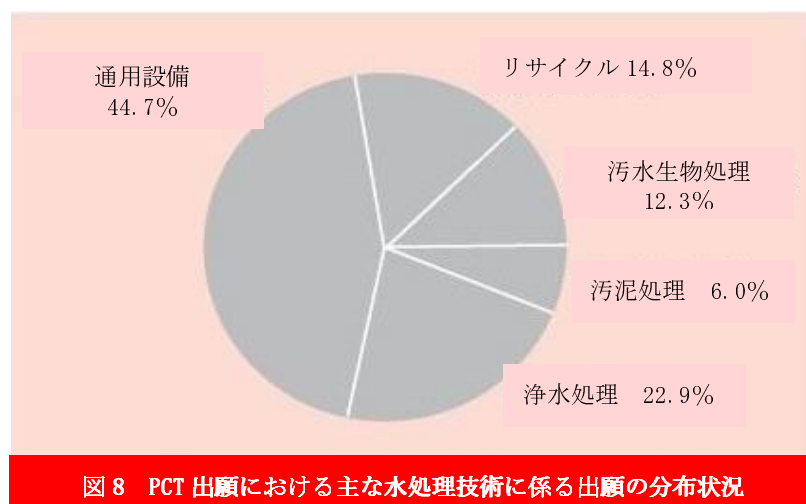


図 8 は、2000 年から 2006 年 9 月までに、PCT 出願における主な水処理技術に係る出願の分布状況を示す図である。



上記図で分かるように、水リサイクルに係る特許出願には、国内出願が22.3%を占め、PCT出願が14.8%を占める。水処理設装置に係る特許出願には、国内出願が37.9%を占め、PCT出願が44.7%を占める。

(2) 地熱資源利用分野における特許出願

2000年から2006年9月までに、地熱資源利用に係る発明及び実用新案特許出願は、616件で、年間伸び率は約68%である。その中、PCT出願は15件で、国内出願は10%の63件である。外国からの出願において、米国と日本との出願は62%の39件である。

図9は、2000年から2005年12月までに、中国発明及び実用新案特許出願量の推移を示す図である。

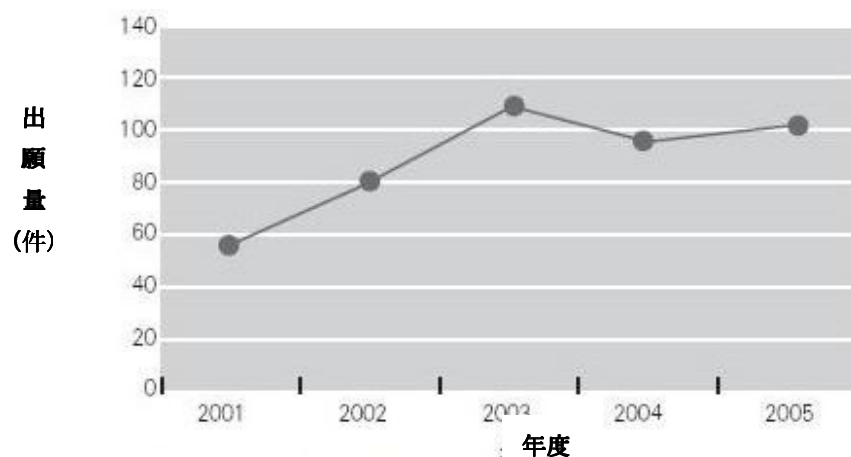


図9 地熱利用分野の特許出願量の推移

図10は、2000年から2006年9月までに、地熱利用分野において発明及び実用新案の特許出願（PCT出願を除く）における中国および外国からの出願量状況を示す図である。

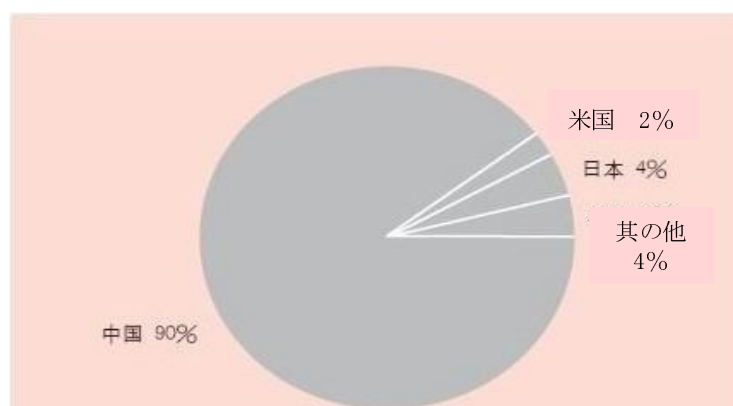
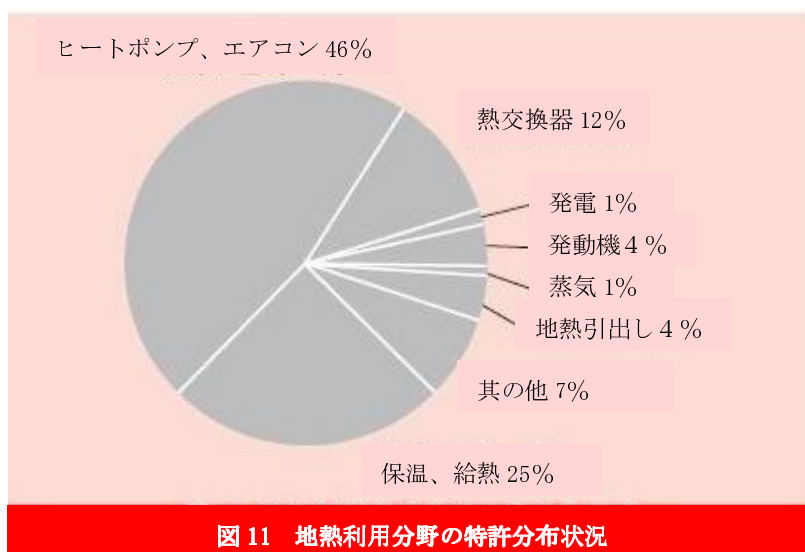


図10 地熱利用分野の中国における特許出願（PCT出願を除く）

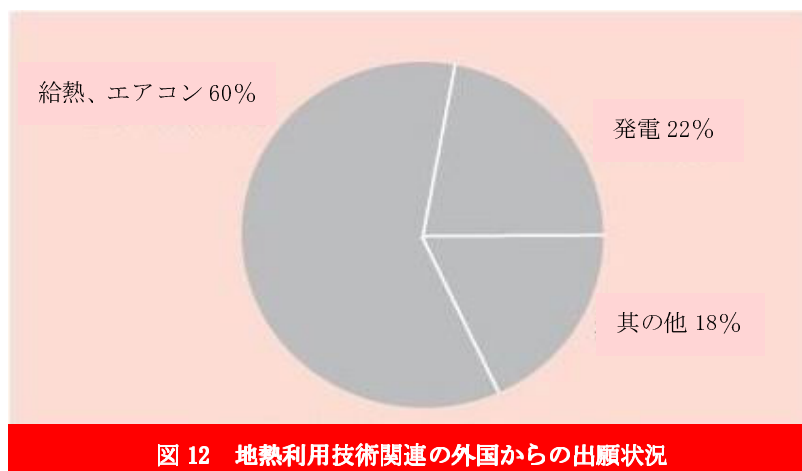
その中、中国国内出願は90%であるが、PCT出願がない。

図 11 は、2000 年から 2006 年 9 月までに、発明及び実用新案特許出願において、地熱利用に係る出願状況を示す図である。



上記図で分かるように、地熱はヒートポンプ、エアコンに用いる技術に係る特許出願は 46%であり、保温、給熱等に直接に地熱資源を用いる特許出願は 25%であり、熱交換器に係る特許出願は 12%であり、この三つの分野で地熱の熱エネルギーを直接または間接に利用して熱交換関連の特許出願は 83%となる。

図 12 は、地熱利用に係る特許出願における外国からの出願（PCT 出願を含む）の分布状況を示す図である。



これで分かるように、地熱の熱エネルギーを直接または間接に利用して熱交換技術関連の特許は 83%で、地熱を利用して発電する特許出願は 22%をしめる。

(3) 風力エネルギー利用技術分野の特許出願

2006年末までに、開示された風力エネルギー利用に係る特許出願は累計1,548件である。図13は、2002年から2006年までの五年間の中で風力エネルギー利用分野に係る特許出願量の推移を示す図である。

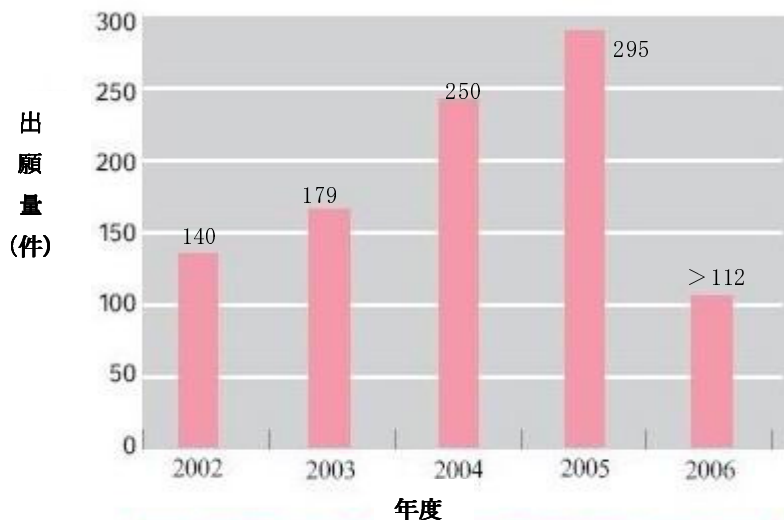


図13 風力エネルギー利用分野に中国特許出願量の推移

これで分かるように、この五年間の特許出願量は1985～2001年の総計17年の特許出願量分の1.71倍である。なお、2006年に出願されたものがその公開された112件で計算する。

図14は、風力エネルギー利用分野における中国および諸外国からの特許出願量の分布状況を示す図である。

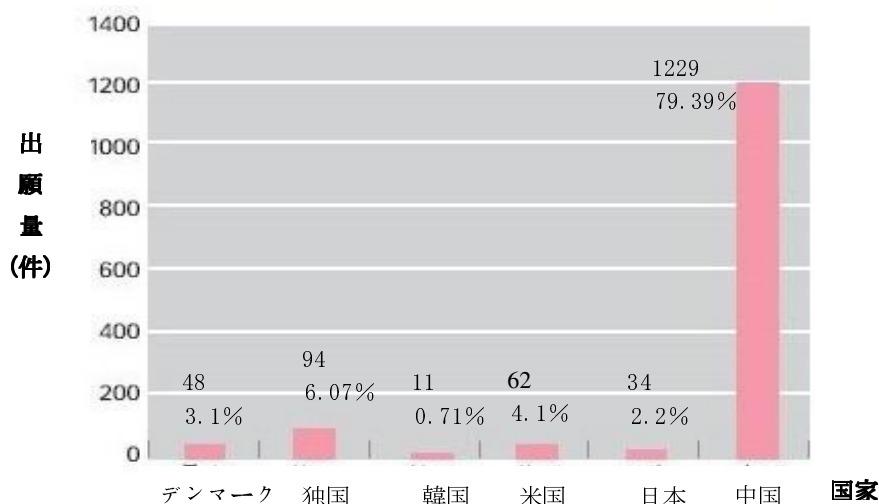


図14 風力エネルギー利用分野に中国および外国からの特許出願量

その中、中国の出願は当該技術分野の出願量の 79.39% の 1,229 件である。当該分野の外国からの出願は 20.61% の 319 件であり、主としては独国、米国、デンマーク、日本、韓国からのものである。

(4) OLED 技術分野の特許技術

図 15 は、1994 年から 2006 年までに、当該分野の特許出願数量を統計する図である（2006 年ではその公開された分のみで統計する）。

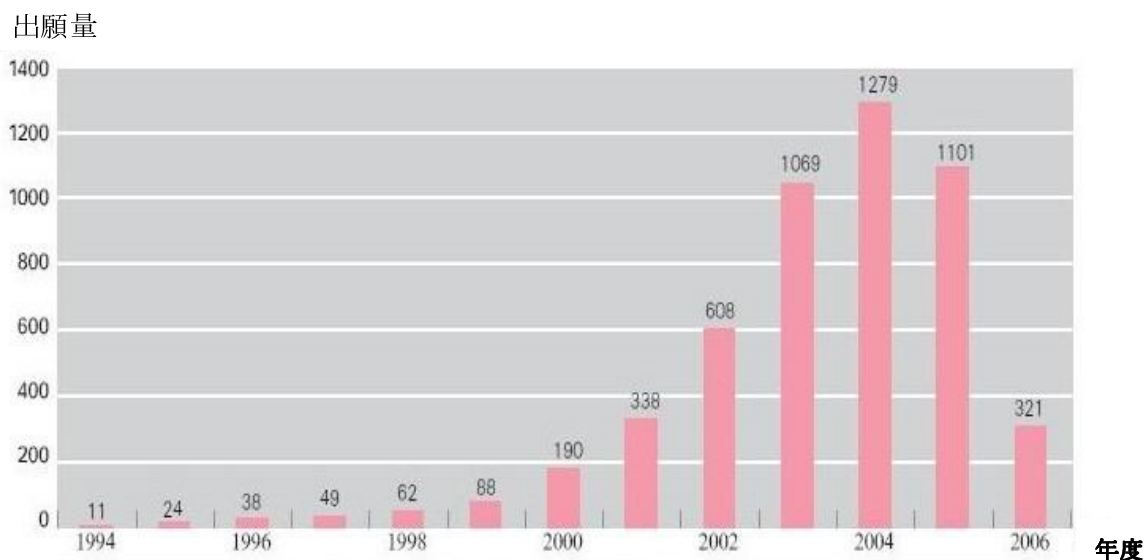


図 15 1994 年から 2006 年まで OLED 分野の特許出願数量の統計

図 16 は、当該技術分野における特許出願を出願人が所属する国家で統計する分布状況を示す図である。

国家		主な部分	出願件数	比率
中国	中国大陸	復旦大学、清華大学、中科院長春光学精密機械与物理研究所、中科院長春応用化学研究所	776 件	14.9%
	台湾地区	友達光電股份有限公司、徠宝科技股份有限公司等	719 件	13.8%
国外		日本 2,099 件, 44.1%	3,718 件	71.3%
		韓国 914 件, 17.5%		
		米国 296 件, 5.6%		
		オランダ等		

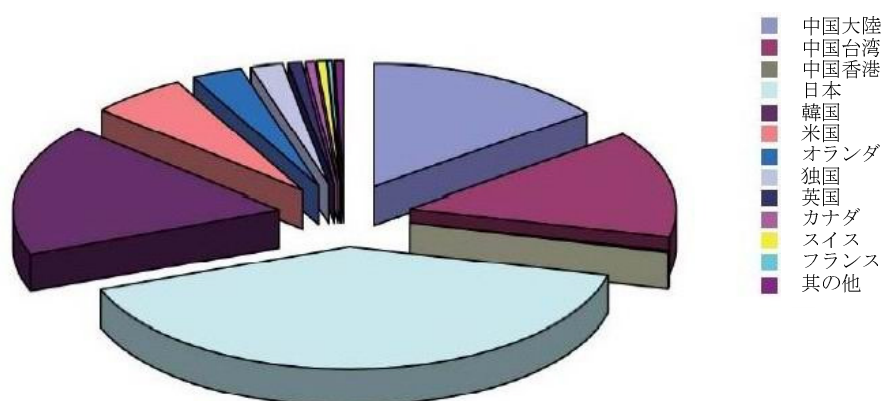


図 16 OLED 分野に特許出願数量の分布状況 (出願人所属国家で統計)

(5) デジタルテレビ技術分野における特許出願の状況

出願量が 20 件を超える外国会社は、24 社であり、そのうち、日本が 10 社、欧州が 6 社、米国が 5 社、韓国が 3 社である。

デジタルテレビ分野において、中国国内特許量は第三位であり、大学及び科研機構の出願量は 46%、企業の出願量は 36%、個人の出願量は 18%である。

表 10 デジタルテレビ分野の特許技術 (国内出願人でソート)

コード	出願人	出願量 (件)
1	清華大学	40
2	浙江大学	32
3	中国科学院計算技術研究所	28
4	上海交通大学	23
5	華為技術有限公司	22
6	電子科技大学 (成都)	16
7	楽金電子有限公司	16
8	聯発科技股份有限公司 (台湾)	16
9	上海広電 (集団) 有限公司	15
10	西安電子科技大学	12
11	復旦大学	11
12	北京中星微電子有限公司	11
13	華邦電子股份有限公司 (台湾)	9
14	矽統科技股份有限公司 (台湾)	9
15	華中科技大学	8

(6) 医学影像分野の特許技術

下表は、医学影像技術に係わる特許出願の現状を示す一覧表である(2006年に公開された161件分の詳細)。

国内出願 38 件	超音波画像処理	21%
	CT 技術	31%
	MRI 技術	5%
外国からの出願 123 件	CR/DR 技術	21%
	PET/SPECT 技術	3%
	その他	19%
国内出願 38 件	伝統技術 (画像処理、採集等を含む)	44%
	多次元画像処理技術	16%
	自動識別と診断	7%
外国からの出願 123 件	ネットワーク又は遠距離診断	1%
	画像合成	2%
	画像導き	2%
	その他	28%

(7) 遺伝子治療分野の特許技術 (2006 年 6 月まで)

図 17 で分かるように、出願量について言えば、国内出願は約半分 (46.44%)、次に、それぞれは米国 21.74%、日本 8.64%、独国 4.25%、英国 4.18%及びフランス 3.02%である。

国内又は外国からの出願を問わず、腫瘍疾病と代謝疾病の遺伝子治療は、一番関心を受ける研究分野であり、次に、心血管疾病と病毒感染疾病、例えば肝炎、エイズの治療も遺伝子治療は主な研究方向である。

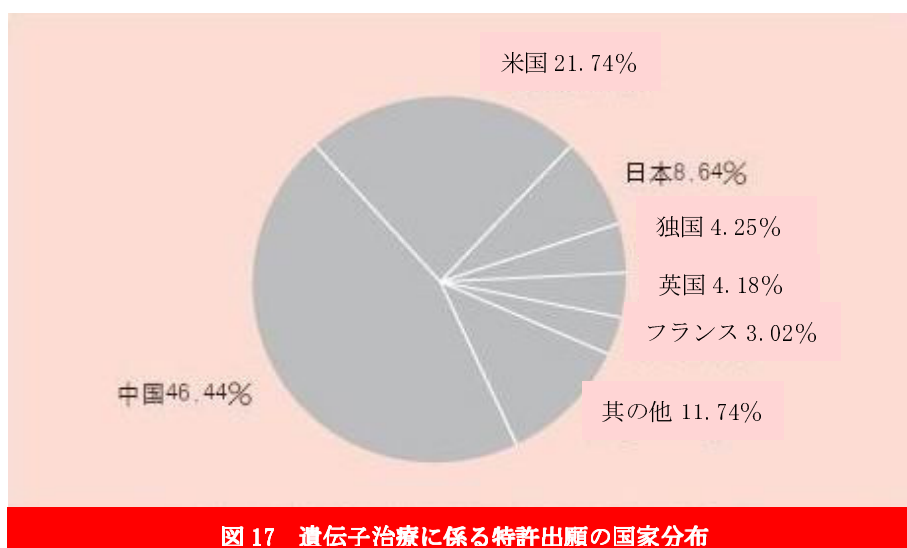


図 18 のデータに基づいて、遺伝子治療に係る国内出願は、主に代謝疾病 (A61P3/00) と腫瘍 (A61P35/00) に集中していると分かる。



図 18 国内出願に係る主な応用分野の分布状況

図 19 のデータに基づいて、遺伝子治療に係る国外出願は、主に腫瘍(A61P35/00)と代謝疾病(A61P3/00) に集中していると分かる。

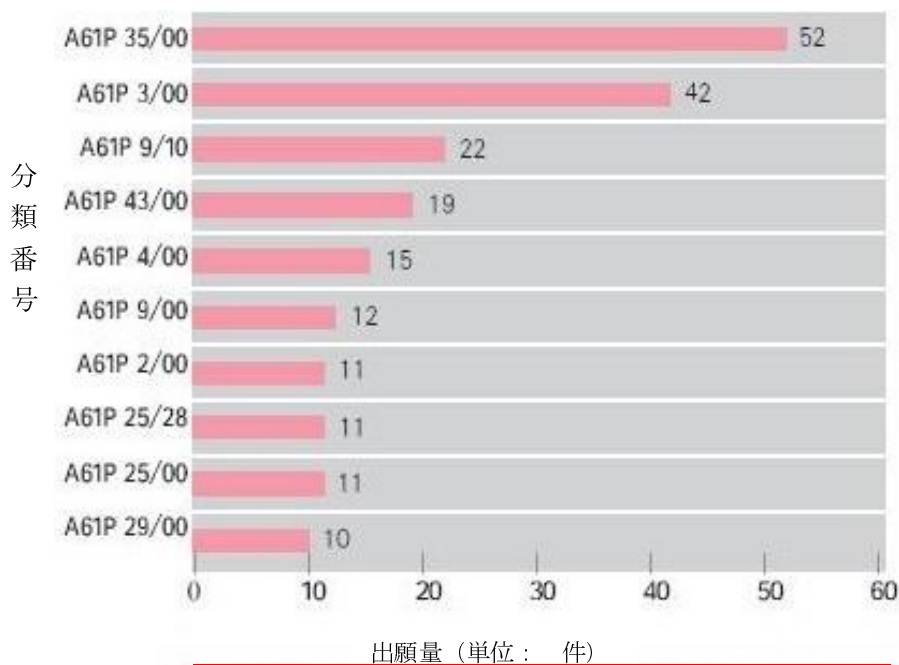


図 19 国外出願に係る主な応用分野の分布状況

(8) 無機ナノテク材料の特許技術

2006 年 12 月 31 日まで、中国無機ナノテク材料分野の特許出願は合計約 1,480 件である。その中、発明特許出願は 1,452 件で、実用新案特許出願は 28 件で、国内出願は 88% の 1,301 件である。

図 20 で分かるように、中国の無機ナノテク材料分野の技術は比較的遅いであるが、2000 年から、迅速的に発展していることが分かる。

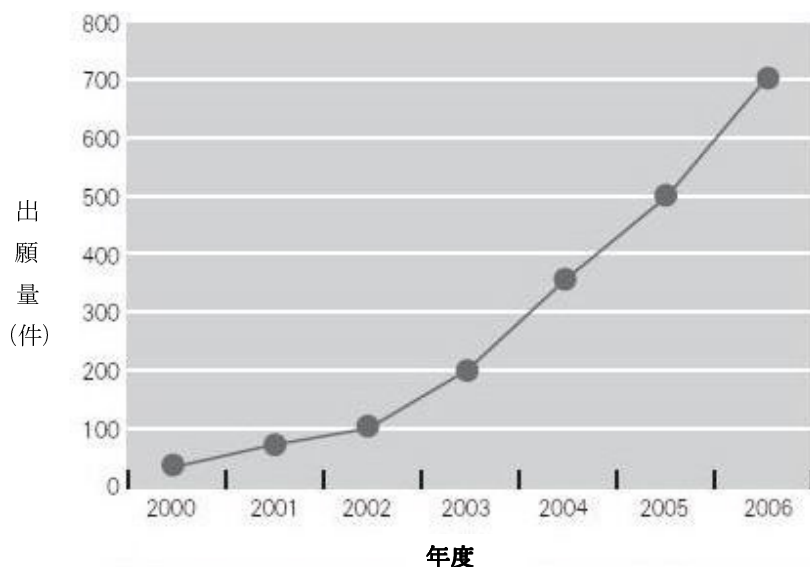


図 20 無機ナノテク材料特許出願量の推移

国際分類番号における無機ナノテク材料の特許出願の分布状況は、図 21 で示す。

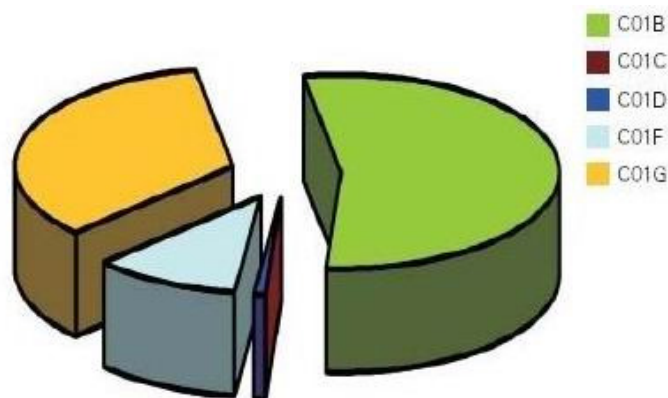


図 21 IPC 出願における無機ナノテク材料特許出願

無機ナノテク材料の特許出願は主に非金属元素に係るナノテク材料 (53.7%をしめる C01B を含む) と金属元素に係るナノテク材料 (10.7%を占める C01F と 34.5%を占める C01G を含む) を含む。

出願内容から見れば、非金属元素に係るナノテク材料の特許出願は主に非金属元素の炭素 (C01B31/00) と珪素 (C01B33/00) に集中し、その中、炭素に係るナノテク材料の特許出願は非金属元素に係るナノテク材料の特許出願の約 60% を占め、珪素に係るナノテク材料

の特許出願は非金属元素に係るナノテク材料の特許出願の約 14%を占め、金属元素に係る特許出願において、チタンに係るナノテク材料の特許出願は 22%を占める。

5、その他の統計資料

表 11 2000-2006年国内、国外三種特許出願量の比較

	合計				国内				国外からの出願			
	合計	発明	実用新案	意匠	合計	発明	実用新案	意匠	合計	発明	実用新案	意匠
累計	2338622	814451	764548	759623	1895336	433548	757404	704384	443286	380903	7144	55239
平均伸び率	22.4%	26.3%	15.3%	26.1%	22.3%	30.0%	15.2%	26.2%	22.6%	22.3%	25.3%	24.4%
2000	170682 27.1%	51747 41.0%	68815 19.7%	50120 25.1%	140339 27.6%	25346 62.5%	68461 19.7%	46532 25.3%	30343 25.0%	26401 25.1%	354 27.3%	3588 23.5%
2001	203573 19.3%	63204 22.1%	79722 15.8%	60647 21.0%	165773 18.1%	30038 18.5%	79275 15.8%	56460 21.3%	37800 24.6%	33166 25.6%	447 26.3%	4187 16.7%
2002	252631 24.1%	80232 26.9%	93139 16.8%	79260 30.7%	205544 24.0%	39806 32.5%	92166 16.3%	73572 30.3%	47087 24.6%	40426 21.9%	973 117.7%	5688 35.8%
2003	308487 22.1%	105318 31.3%	109115 17.2%	94054 18.7%	251238 22.2%	56769 42.6%	107842 17.0%	86627 17.7%	57249 21.6%	48549 20.1%	1273 30.8%	7427 30.6%
2004	353807 14.7%	130133 23.6%	112825 3.4%	110849 17.9%	278943 11.0%	65786 15.9%	111578 3.5%	101579 17.3%	74864 30.8%	64347 32.5%	1247 -2.0%	9270 24.8%
2005	476264 34.6%	173327 33.2%	139566 23.7%	163371 47.4%	383157 37.4%	93485 42.1%	138085 23.8%	151587 49.2%	93107 24.4%	79842 24.1%	1481 18.8%	11784 27.1%
2006	573178 20.3%	210490 21.4%	161366 15.6%	201322 23.2%	470342 22.8%	122318 30.8%	159997 15.9%	188027 24.0%	102836 10.4%	88172 10.4%	1369 -7.6%	13295 12.8%

表 12 2000-2006年国内職務、非職務特許出願量の比較

	非職務	職務				
		合計	大学	研究機関	企業	機関団体
累計	1124431	770905	78835	47186	634662	10222
累計伸び率	20.5%	25.0%	41.0%	15.7%	24.0%	42.2%
2000	86964 20.8%	53375 40.6%	2924 65.3%	4122 35.2%	45862 40.5%	467 -7.2%
2001	105669 21.5%	60104 12.6%	3810 30.3%	4360 5.8%	51302 11.9%	632 35.3%
2002	124302 17.6%	81242 35.2%	5981 57.0%	5373 23.2%	68962 34.4%	926 46.5%
2003	148782 19.7%	102456 26.1%	10252 71.4%	6998 30.2%	84117 22.0%	1089 17.6%
2004	167663 12.7%	111280 8.6%	12997 26.8%	6709 -4.1%	90148 7.2%	1426 30.9%
2005	224275 33.8%	158882 42.8%	19921 53.3%	9746 45.3%	127397 41.3%	1818 27.5%
2006	266776 19.0%	203566 28.1%	22950 15.2%	9878 1.4%	166874 31.0%	3864 112.5%